

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012年5月3日(03.05.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/056513 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/00 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
B28D 5/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/068911
- (22) 国際出願日: 2010年10月26日(26.10.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社(TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 中井 良之(NAKAI, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 小川 一幸(OGAWA, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 中村 賢治(NAKAMURA, Kenji) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1

丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内
Osaka (JP).

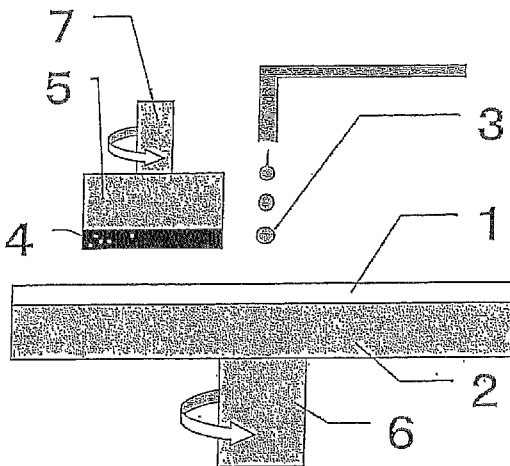
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13-9 新大阪MTビル1号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

[続葉有]

(54) Title: POLISHING PAD AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 研磨パッド及びその製造方法

[図1]



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide: a polishing pad that improves dressing properties, and with which the surface of an object to be polished is not easily scratched; and a method for producing the polishing pad. This polishing pad has an abrasive layer comprising non-foamed polyurethane. The non-foamed polyurethane is a reaction-hardened body of a polyurethane raw material composition containing: an isocyanate-terminated prepolymer (A) obtained by reacting a prepolymer (A) raw material composition containing a diisocyanate, a high-molecular-weight polyol (a) and a low-molecular-weight polyol; an isocyanate-modified body polymerized by adding at least 3 diisocyanates; an isocyanate-terminated prepolymer (B) obtained by reacting a prepolymer (B) raw material composition containing a high-molecular-weight polyol (b); and a chain extender. The polishing pad is characterized in that the added quantity of the isocyanate-terminated prepolymer (B) is 5 to 30 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the isocyanate-terminated prepolymer (A).

(57) 要約: 本発明は、研磨対象物の表面にスクラッチを生じさせ難く、かつドレッシング性を向上させた研磨パッド及びその製造方法を提供することを目的とする。本発明の研磨パッドは、無発泡ポリウレタンは、ジイソシアネート、高分子量ポリオール(a)、及び低分子量ポリオールを含むプレポリマーA原料組成物を反応して得られるイソシアネート末端プレポリマーA、3つ以上のジイソシアネートが付加することにより多量化したイソシアネート変性体、及び高分子量ポリオール(b)を含むプレポリマーB原料組成物を反応して得られるイソシアネート末端プレポリマーB、及び鎖延長剤を含むポリウレタン原料組成物の反応硬化体であり、イソシアネート末端プレポリマーBの添加量は、イソシアネート末端プレポリマーA 100重量部に対して5~30重量部であることを特徴とする。



GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))